

УДК 539.213

© 1991

**РАССЕЯНИЕ РЕНТГЕНОВСКИХ ЛУЧЕЙ  
И ОПТИЧЕСКОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ  
В АМОРФНЫХ ПЛЕНКАХ Y—Ba—Cu—O**

*B. D. Окунев, З. А. Самойленко*

Установлено, что структура исследуемых пленок наследует двухфазное состояние, свойственное мишениям. Основную роль в когерентном рассеянии рентгеновского излучения играют фрагменты кристаллоидобных плоскостей (001), соответствующих одноименным базисным плоскостям элементарных ячеек кристаллов  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$  и  $\text{Y}_2\text{BaCuO}_5$ . Изучение спектров оптического поглощения подтвердило наличие в пленках двух аморфных фаз со значениями оптической ширины запрещенной зоны 0.5 и 1.52 эВ; количественные оценки, полученные для соотношения этих фаз, хорошо согласуются с рентгеновскими данными и соответствуют соотношению между фазами  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$  и  $\text{Y}_2\text{BaCuO}_5$  в мишениях.

Получение пленок высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) нередко связано с их аморфным состоянием [1–3], которое во многом определяет свойства ВТСП, формирующиеся при последующей термообработке образцов. Однако в литературе практически отсутствуют сведения об аморфном состоянии этих материалов, представляющие интерес не только для расширения существующих представлений о структуре и свойствах некристаллических веществ, но и для понимания особенностей технологических процессов получения ВТСП. Внимание к аморфным слоям ВТСП связано также и с возможностью их непосредственного практического использования в качестве защитных и маскирующих покрытий для сверхпроводящих пленок аналогичного состава. В настоящей работе представлены результаты исследований структуры и оптических свойств аморфных пленок Y—Ba—Cu—O.

### 1. Методика эксперимента

Пленки толщиной от 0.1 до 5 мкм получены распылением керамических сверхпроводящих мишней Y—Ba—Cu—O в атмосфере аргона на постоянном токе при осаждении распыляемого материала на стеклянные (плоские или цилиндрические) подложки. Температура подложек в процессе роста не превышала 100 °C. Изготовленные по керамической технологии мишени диаметром 18–25 мм и толщиной 3–5 мм являлись двухфазными и наряду с основной орторомбической фазой ' $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ ' содержали фазу  $\text{Y}_2\text{BaCuO}_5$  (до 49 %), которая в небольшом количестве практически всегда присутствует в сверхпроводящей иттриевой керамике. Исследовались две группы образцов (A и B), для изготовления которых использовались мишени различного фазового состава с целью исследования влияния структуры распыляемого материала на свойства пленок.

Структура пленок исследовалась рентгеновским методом: анализировалась дифракционная картина (в лучах  $\text{CrK}_\alpha$ ), полученная на рентгенограммах в камере Дебая при комнатной температуре. Для исследования структуры использовались в основном образцы цилиндрической формы

(пленки, осажденные на тонкие стеклянные капилляры диаметром 0.05—0.1 см).

Ширина запрещенной зоны образцов определялась из данных по оптическому поглощению. Спектры поглощения образцов были получены с использованием спектрофотометра SP700C, рабочий диапазон которого включает в себя интервал длин волн, соответствующий краю поглощения исследуемых пленок.

## 2. Рентгеновские дифракционные картины пленок

Рассеянное рентгеновское излучение анализировалось во всех углах дифракции. На дифракционных картинах наблюдались диффузные максимумы (гало) и фон, увеличивающийся с ростом угла рассеяния. Максимумы получаются в результате интерференции рентгеновских лучей, рассеянных когерентно от упорядоченно расположенных атомов в облучаемом образце. Фон является результатом некогерентного рассеяния рентгеновского излучения от неупорядоченно расположенных атомов [4].

На дифракционных картинах пленок наблюдались два гало, расположенные рядом в малых углах дифракции (более интенсивное под

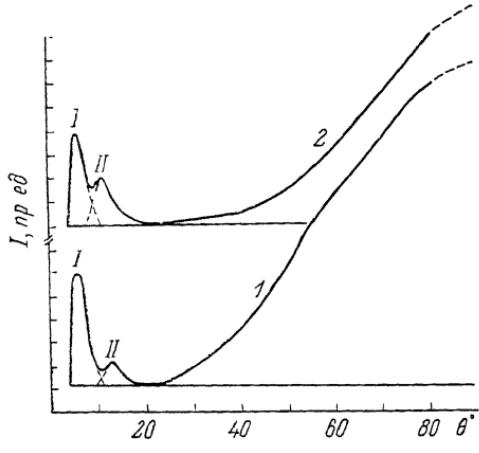


Рис. 1. Дифракционные картины аморфных пленок Y—Ba—Cu—O.

1 — группы А, 2 — группы В.

углом  $\theta_1 = 5.71^\circ$  и менее интенсивное под углом  $\theta_2 = 8.44^\circ$ ), и фон, увеличивающийся с ростом угла  $\theta$  (рис. 1). Интегральные интенсивности гало I и II невелики. Их суммарная доля в полной интенсивности рассеянного излучения составляет около 4 % для образцов группы А и 12 % для образцов группы В. Положениям максимумов гало соответствуют межплоскостные расстояния  $d_I = 11.5 \text{ \AA}$  и  $d_{II} = 7.8 \text{ \AA}$ . Такие параметры характерны для дифракционных отражений от плоскостей (001) соответственно фазы  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$  (гало I) и  $\text{Y}_2\text{BaCuO}_5$  (гало II). Специальные эксперименты пока-

### Фазовый состав (в %) мишней и пленок

Объект	Метод измерения	Группа А		Группа В	
		$\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$	$\text{Y}_2\text{BaCuO}_5$	$\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$	$\text{Y}_2\text{BaCuO}_5$
Мишень	Рентгеновский	88	12	51	49
Пленка	То же	87.8	12.1	59.3	40.7
	Оптический	87	13	42	58

зали, что эти гало в малых углах воспроизводятся, если температура подложек при росте пленки не превышает  $200^\circ\text{C}$ . При более высоких температурах роста вместо малоугловых гало появляются гало в средних углах рассеяния ( $\theta \approx 23 \div 25^\circ$ ), где сосредоточены наиболее интенсивные линии кристаллических фаз. Соотношение интегральных интенсивностей гало I и II с большой точностью совпадает с соотношением кристаллических фаз в распыляемых мишнях, определяемых методом количественного фазового анализа, что видно из таблицы.

### 3. Спектры оптического поглощения образцов

Спектры оптического поглощения двух серий образцов различного состава, снятые при комнатной температуре, приведены на рис. 2. Край оптического поглощения расположен при  $\hbar\omega \sim 0.5$  эВ. Нельзя не обратить внимания на слабую зависимость коэффициента оптического поглощения  $\alpha$  от  $\hbar\omega$  (размытый край) и ее явное несоответствие правилу Урбаха. Кривые на рис. 2, с являются монотонными без каких-либо значительных особенностей; некоторое отклонение их от нормального хода наблюдается при  $\hbar\omega > 2.0$  эВ для образцов группы А и при  $\hbar\omega > 1.5$  эВ для образцов группы В. В интервалах  $\hbar\omega 0.8-2$  и  $0.8-1.5$  эВ соответственно эти две кривые описываются известной зависимостью [5]

$$\alpha(\hbar\omega) \sim \frac{(\hbar\omega - E_{01})^2}{\hbar\omega}, \quad (1)$$

полученной в предположении о параболических зонах и при учете оптических переходов только между делокализованными состояниями (рис. 2, d). Значение оптической ширины запрещенной зоны  $E_{01}$ , как видно из

Рис. 2. Спектры оптического поглощения аморфных пленок Y-Ba-Cu-O.

с: 1, 2 — экспериментальные зависимости  $\alpha$  от  $\hbar\omega$  для групп А и В соответственно; 1а, 2а — расчетные зависимости  $\alpha_1, x$  от  $\hbar\omega$  для пленок группы А и В соответственно ( $\alpha_1$  — коэффициент оптического поглощения,  $x$  — концентрация основной аморфной фазы YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7-δ</sub>); 1б, 2б — расчетные зависимости  $\alpha_2(1-x)$  от  $\hbar\omega$  для пленок групп А и В соответственно ( $\alpha_2$  — коэффициент оптического поглощения,  $(1-x)$  — концентрация аморфной фазы Y<sub>2</sub>Ba<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7</sub>); д: кривые рис. 2, с перестроены в координатах, соответствующих формуле (1).

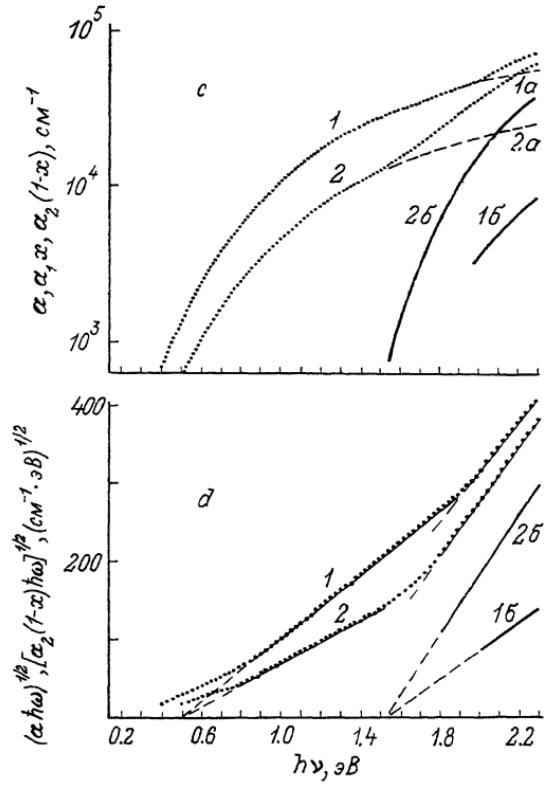


рис. 2, d, составляет  $0.5 \pm 0.01$  эВ для образцов обеих групп независимо от величины  $\alpha$  и конкретной зависимости  $\alpha = \alpha(\omega)$ . Отсюда очевидно, что  $E_{01} = 0.5$  эВ есть оптическая ширина запрещенной зоны вполне определенной аморфной фазы, являющейся в данном случае основной, содержание которой в пленках зависит от состава исходного материала, используемого в качестве мишени. Понятие «фаза» относится к результату статистического усреднения по ансамблю совокупности малых элементов с одинаковой структурой ближнего порядка. Следует полагать, что отклонение от нормального хода зависимости  $\alpha(\omega) \sim (\hbar\omega - E_{01})^2/\hbar\omega$  при больших значениях  $\hbar\omega$  на рис. 2, с и д обусловлено наличием в пленках второй аморфной фазы. Непосредственное определение оптической ширины запрещенной зоны  $E_{02}$  для этой фазы по ходу кривых 1 и 2 на рис. 2, d оказывается невозможным, поскольку значение отсечки (значение  $\hbar\omega$  при  $(\alpha\hbar\omega)^{1/2} = 0$ ) оказывается зависящим от концентрации основной фазы, которая в обоих случаях дает значительный вклад в оптическое поглощение образцов. Для определения спектров поглощения второй аморфной фазы в пленках можно воспользоваться хорошо известным правилом аддитивности коэффициентов поглощения

$$\alpha(\omega) = \alpha_1(\omega)x + \alpha_2(\omega)(1-x), \quad (2)$$

где  $x$  — концентрация основной стеклообразной фазы, а индексы 1, 2 относятся к соответствующим фазам. Формула (2) применима для двухфазной системы при отсутствии анизотропии в распределении структурных элементов. При  $\hbar\omega < 1.5$  эВ вторая фаза не оказывает влияния на спектральную зависимость  $\alpha$ , характеризующуюся соотношением (1), и полный коэффициент поглощения в этой области  $\hbar\omega \alpha(\omega) \approx \alpha_1(\omega)x$ . Аппроксимируя дальнейший ход зависимости  $\alpha_1 = \alpha_1(\omega)$  для основной фазы при больших  $\hbar\omega$  соотношением (1) с  $E_{01} = 0.5$  эВ (кривые 1а и 2а на рис. 2, с), можно получить спектры поглощения второй аморфной фазы. Кривые 1б и 2б, являющиеся результатом вычитания кривых 1, 1а и 2, 2а, представляют собой зависимости  $\alpha_2(1-x)$  от  $\hbar\omega$  для образцов обеих групп. Спектральная зависимость  $\alpha_2 = \alpha_2(\omega)$  описывается соотношением, аналогичным формуле (1), где значение оптической ширины запрещенной зоны для второй аморфной фазы  $E_{02} = 1.52 \pm 0.02$  эВ (это иллюстрируется прямыми 1б и 2б на рис. 2, д) втрое превышает значение  $E_{01}$ .

Данные, представленные на рис. 2, позволяют выполнить количественный фазовый анализ образцов. Количественные оценки для соотношения двух аморфных фаз, полученные с использованием данных по оптическому поглощению и включенные в таблицу, близки к соотношению фаз  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$  и  $\text{Y}_2\text{BaCuO}_5$  в кристаллических мишениях.

#### 4. Обсуждение результатов

Данная ситуация, когда гало на дифракционной картине наблюдаются в столь малых углах, а не на месте наиболее интенсивных линий кристаллических фаз (что характерно для обычных аморфных металлических и полупроводниковых материалов), является уникальной. Значения  $d$ , соответствующие положениям этих двух гало в малых углах, на порядок превышают значения средних межатомных расстояний. Очевидно, что данный тип дифракционных картин нельзя описать с помощью каких бы то ни было разновидностей модели неупорядоченной случайной сетки, поскольку в этих моделях положение первого дифракционного максимума заведомо не может соответствовать положению гало, наблюдающемуся в эксперименте. Единственная разумная возможность объяснения результатов по дифракции в этом случае связана с участием в рассеянии кристаллоподобных базисных плоскостей (001), формирующихся в неупорядоченной среде в результате самоорганизации составляющих их атомов под влиянием сил химической связи. Базисные плоскости ( $ab$ ), расстояния между которыми соответствуют расстояниям между одноименными плоскостями элементарной ячейки кристалла, являются наиболее совершенными элементами структуры пленок. Эти плоскости, а точнее их небольшие фрагменты с кристаллоподобной упаковкой атомов, участвуют в когерентном рассеянии рентгеновских лучей, формируя гало на дифракционной картине. В отличие от кластерной структуры известных аморфных полупроводников [6-9] в исследуемых образцах расстояния между плоскостями, когерентно рассеивающими излучение, велики; между ними имеется большое количество атомов (и возможных плоскостей), у которых отсутствует порядок во взаимном расположении. Эти атомы относятся к неупорядоченной среде, дающей основной вклад в некогерентное рассеяние рентгеновского излучения и усиливающей фон, пропорциональный  $\sin^2\theta$ .

Оценка по методике [10] линейных размеров двумерных областей с упорядоченной структурой, определяющих масштаб промежуточного порядка в исследуемых пленках, дает значения 50—90 Å. Прямым подтверждением существования неоднородностей структуры мезоскопического масштаба в аморфных пленках Y—Ba—Cu—O являются результаты их электронно-микроскопических исследований [11]. В [11] наблюдалась структурные неоднородности, названные авторами псевдозернами, размером 20—50 Å.

В заключение необходимо сделать пояснение к приведенной таблице.

Доля объема, когерентно рассеивающего рентгеновские лучи, невелика и по порядку величины соответствует суммарному вкладу обоих гало в полную дифракционную картину. Поэтому фазовый состав пленок, определенный рентгеновским методом по соотношению интегральных интенсивностей гало, фактически характеризует лишь объемное соотношение двух типов структурных образований мезоскопического масштаба с кристаллоподобной упаковкой атомов. Напротив, оптические измерения относятся к среде с неупорядоченным расположением атомов, занимающей основную долю объема образцов. Совпадение данных о соотношении аморфных фаз в пленках, полученных рентгеновским и оптическим методами, указывает на качественное соответствие структуры неупорядоченной среды, характеризующейся наличием только ближнего порядка в расположении атомов, структуре кристаллоподобных образований с упорядоченным расположением атомов, имеющих наряду с ближним и промежуточный порядок. Причем везде сохраняется соотношение фаз  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$  и  $\text{Y}_2\text{BaCuO}_5$ , свойственное мишеням.

### Список литературы

- [1] Yavari A. R., Lejay P. // J. Cryst. Growth. 1988. V. 91. P. 290–294.
- [2] Головчанский М. Е., Ермолов С. Н., Костылева О. П., Коханчик Л. С., Марченко В. А., Никулов А. В., Розенфланц В. Ж. // Письма в ЖТФ. 1989. Т. 15. № 3. С. 51–55.
- [3] Kiilio Matsuzaki, Akihisa Inoue, Hisamichi Kimura, Keiji Moroishi, Tsuyoshi Masumoto. // Jap. J. Appl. Phys. 1987. V. 26. N 4. P. L334–L336.
- [4] Архаров В. И., Самойленко З. А. // ФММ. 1983. Т. 55. № 1. С. 143–148.
- [5] Мотт Н., Дэвис Э. Электронные процессы в некристаллических веществах. М.: Мир, 1982. 662 с.
- [6] Окунев В. Д., Самойленко З. А. // Письма в ЖЭТФ. 1986. Т. 43. № 1. С. 24–27.
- [7] Окунев В. Д., Самойленко З. А. // Письма в ЖТФ. 1988. Т. 14. № 17. С. 1621–1625.
- [8] Окунев В. Д., Пафомов Н. Н., Самойленко З. А. // ФТТ. 1988. Т. 30. № 5. С. 1344–1351.
- [9] Окунев В. Д., Самойленко З. А. // ФТТ. 1989. Т. 31. № 9. С. 257–259.
- [10] Китайгородский А. И. Рентгеноструктурный анализ мелкокристаллических и аморфных тел. М.; Л., 1952. 588 с.
- [11] Котлярчук Б. К., Попович Д. И., Флис А. А., Флис В. С. // Тез. докл. II Всес. конф. по высокотемпературной сверхпроводимости. Киев, 1989. Т. 2. С. 361.

Донецкий  
Физико-технический институт  
АН УССР

Поступило в Редакцию  
10 декабря 1990 г.